Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

Методические указания к лабораторной работе № 78 по дисциплине «Физика»

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Кафедра физики

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

Методические указания к лабораторной работе № 78 по дисциплине «Физика»

УДК ББК

Исследование полупроводникового диода: Методические указания к лабораторной работе \mathbb{N} 78 по дисциплине «Физика» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост. С. Н. Сазонов — Уфа, 2015. — 17 с.

Цель указаний методических закрепление совершенствование знаний студентов по дисциплине «Физика» и формирование умений применять ИХ ДЛЯ решения научнотехнических теоретических прикладных задач В И профессиональной возникающих В последующей деятельности выпускников технического университета.

Изучается строение собственных и примесных полупроводников и свойства p-n- перехода.

Приведены краткая теория работы *p-n-* перехода и необходимые для её понимания сведения из физики твёрдого тела, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы и форма отчетности.

Предназначены для студентов, изучающих дисциплину «Физика» по разделу «Оптика и атомная физика» на всех направлениях подготовки бакалавров и специалистов.

Табл. 2. Ил. 11. Библ.: 2 назв.

Рецензенты: д-р физ.-мат. наук, доц. Михайлов Г. П., канд. тех. наук, доц. Иванов М. П.

©Уфимский государственный авиационный технический университет, 2015

Содержание

Введение	4
1. Цели работы	5
2. Задача	5
3. Теоретическая часть	5
3.1. Собственные полупроводники	5
3.2. Примесные полупроводники <i>n</i> - типа	7
3.3. Примесные полупроводники <i>p</i> - типа	8
3.4. Контакт электронного и дырочного полупроводников	
(р-п- переход)	10
4. Экспериментальная установка	13
5. Требования по технике безопасности	13
6. Задания	13
7. Методика выполнения заданий	13
Контрольные вопросы	16
Требования к содержанию и оформлению отчёта	17
Критерии результативности выполнения лабораторной работы	17
Список литературы	17

Введение

Полупроводниковым диодом называется прибор двумя внешними выводами, содержащий внутри один р-п- переход. Такой реализуется границе полупроводника переход на р- типа, называемого акцепторным, *n*- полупроводника, И называемого донорным. Это ОДНО распространённых устройств И3 самых электроники. р-и- переход диода имеет одностороннюю проводимость. Ниже изложены физические принципы работы диода.

В результате выполнения данной лабораторной работы формируются следующие компетенции:

- способность демонстрировать базовые знания в области общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности;
- способность проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать результаты, оценивать их погрешность и достоверность.

Перечисленные компетенции формируются через умения:

- работать с измерительными приборами;
- рассчитывать физические величины по экспериментальным данным;
 - анализировать результаты опыта;
 - оформлять отчет;
 - а также владения:
 - теоретическим материалом;
 - навыками измерения физических величин по приборам;
 - технологией обработки экспериментальных данных.

Лабораторная работа № 78

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ

- 1. Изучение вольт-амперной характеристики диода.
- 2. Изучение зависимости сопротивления диода от величины приложенного напряжения.

2. ЗАДАЧА

Приобретение навыков проведения измерений и умения обработки экспериментальных данных, характеризующих работу диода в электрических схемах.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Полупроводниками называется группа веществ, удельное сопротивление которых изменяется в широких пределах: от 10^{-5} до 10 +8 Ом·м. Характерным для полупроводников является изменение действием электропроводности под факторов: ИХ внешних температуры, освещения, давления, ЧТО позволяет создавать чувствительные термосопротивления, фотосопротивления и т.п.

С точки зрения зонной теории полупроводниками являются кристаллические вещества, у которых при 0 К валентная зона полностью заполнена электронами, а ширина запрещенной зоны невелика (порядка 1 эВ). Поэтому при абсолютном нуле полупроводник, как и диэлектрик, обладает нулевой проводимостью.

Различают собственные и примесные полупроводники. К числу собственных относятся химически чистые полупроводники (германий, кремний, селен и др.). Электрические свойства примесных полупроводников определяются имеющимися в них искусственно вводимыми примесями.

3.1. Собственные полупроводники

В таких полупроводниках атомы нейтральны и связаны друг с другом ковалентными связями. Чтобы создать проводимость, необходимо разорвать хотя бы одну из связей, удалив электрон из атома, например, германия и перенеся его в какую-либо другую кристаллическую ячейку, где все связи заполнены, и этот электрон

будет лишним. Такой электрон в дальнейшем может свободно переходить из одной кристаллической ячейки в другую, перенося с собой избыточный отрицательный заряд, то есть становится электроном проводимости. В атоме же германия, в его валентной оболочке, образуется вакантное место, которое называется дыркой. Дырка перемещается по кристаллу, поскольку электрон соседнего атома быстро занимает место ушедшего. Отсутствие электрона означает наличие у атома германия единичного положительного заряда, который переносится вместе с дыркой.

На рис. 3.1, а показаны энергетические зоны собственного полупроводника при $T \to 0$ К: валентная зона I заполнена электронами полностью, уровни зоны проводимости II свободны.

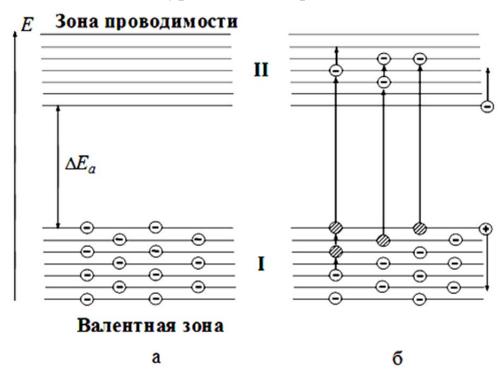


Рис. 3.1. Энергетическая зонная диаграмма собственного полупроводника. На вертикальной оси энергия электронов

С повышением температуры вследствие термического возбуждения электронов валентной зоны часть из них приобретает энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны (ΔE_a) и перехода в зону проводимости. Это приводит к появлению в зоне проводимости свободных электронов, а в валентной зоне – дырок, которые ведут себя как частицы с положительным зарядом (рис. 3.1, б).

При наложении электрического поля электроны зоны **II** начинают переходить на более высокие энергетические уровни, т.к. они свободны. В зоне **I** электроны под действием поля также

получают возможность переходить на более высокие энергетические уровни, занимая вакантное место дырки, в результате чего появляется новая дырка ниже первоначальной, наблюдается движение дырок в зоне \mathbf{I} сверху вниз. Таким образом, в собственных полупроводниках электроны в зоне \mathbf{II} являются отрицательными носителями тока, дырки в зоне \mathbf{I} — положительными носителями.

3.2. Примесные полупроводники *n*-типа

Предположим, что в кристаллической решетке германия (Ge) часть атомов замещена атомами большей валентности, например, атомами пятивалентного мышьяка (As) (рис. 3.2, a).

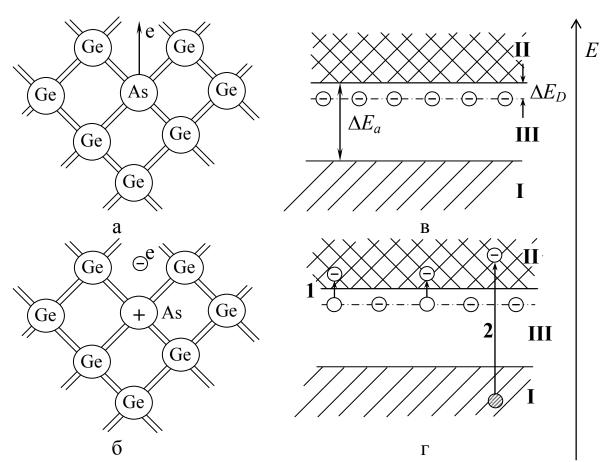


Рис. 3.2. Энергетическая зонная диаграмма *n*- полупроводника

Для образования ковалентной химической связи с соседними атомами германия атом мышьяка расходует четыре валентных электрона, пятый электрон в образовании связи не участвует. При сообщении этому «лишнему» электрону энергии ≈ 0.01 эВ он может оторваться от атома мышьяка и свободно перемещаться в решетке германия, превращаясь, таким образом, в электрон проводимости (рис. 3.2, б). Примеси, являющиеся источниками электронов,

называются донорными, а полупроводники, содержащие такую примесь, электронными полупроводниками или полупроводниками n- типа.

С точки зрения зонной теории этот процесс можно представить следующим образом. При абсолютном нуле между заполненной валентной зоной I и свободной зоной проводимости II располагаются энергетические уровни мышьяка, заполненные электронами (рис. 3.2, в). Эти уровни, называемые донорными, находятся непосредственно у «дна» зоны II, на расстоянии $\Delta E_D \approx 0.01$ эВ от нее.

 ΔE_D называется энергией ионизации донорного примесного атома. С повышением температуры тепловое движение «выбрасывает» в зону II электроны с донорных уровней (рис. 3.2, г). При наложении электрического поля эти электроны перемещаются в энергетические уровни этой 30НЫ Образующиеся при переходах 1 (рис. 3.2, г) положительные заряды локализуются на донорных уровнях и в проводимости не участвуют. Наряду с переходами типа 1 возможны переходы электронов из валентной зоны I в зону проводимости II. Поскольку энергия ионизации донорного атома много меньше ширины запрещенной зоны ($\Delta E_{D} << \Delta E_{a}$), то при не очень высоких температурах первый из этих процессов (1 на рис. 3.2, г) оказывается доминирующим. Концентрация электронов в зоне ІІ при этом во много раз больше концентрации дырок в зоне І. В таких условиях электроны называются основными носителями, а дырки – неосновными.

3.3. Примесные полупроводники р- типа

Полупроводники p- типа могут быть получены, если в решетке германия часть атомов замещена атомами меньшей валентности, чем атомы германия, например, при введении в качестве примеси индия (In) (рис. 3.3, a).

Три электрона атома In участвуют в образовании валентной связи с соседними атомами германия, но на образование связи с четвертым атомом германия у индия не хватает электрона. Индий обладает свойством притягивать к себе электроны, являясь акцептором. На образование четвертой связи он «заимствует» электрон у атома германия. Расчет показывает, что для этого требуется энергия $\Delta E_A \approx 0.01$ эВ, называемая энергией ионизации акцепторного атома. В валентной оболочке германия образуется

вакантное место – дырка (рис. 3.3, б).

Представим этот процесс с точки зрения зонной теории. Введение индия в кристалл германия приводит к появлению в запрещенной зоне ${\bf III}$ примесного уровня, называемого акцепторным, который располагается у «потолка» зоны ${\bf 1}$ на расстоянии ΔE_A от нее. При абсолютном нуле он ничем не заполнен, т.к. при этих условиях невозможен отрыв электрона от атома германия (рис. 3.3, в).

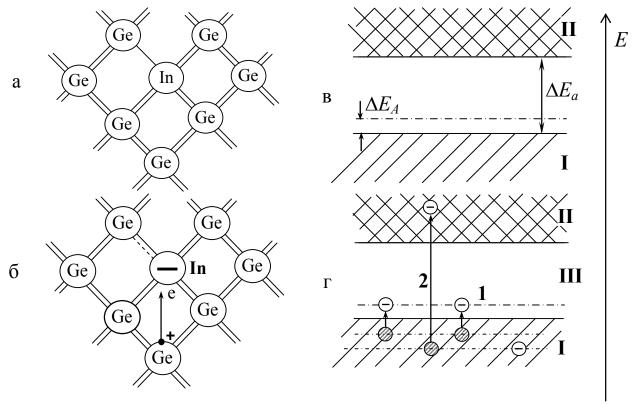


Рис. 3.3. Энергетическая зонная диаграмма p- полупроводника

С повышением температуры электроны из валентной зоны переходят на примесные уровни (рис. 3.3, г), в результате чего в зоне **I** появляются дырки, являющиеся носителями положительного заряда. Электроны, перешедшие из зоны **I** на примесный уровень, связываются с атомами индия и в проводимости не участвуют. Наряду с переходом **1** (рис. 3.3, г), возможен переход **2**, приводящий к появлению в зоне **II** отрицательных носителей тока — электронов. Но так как $\Delta E_A \ll \Delta E_a$, первый процесс является доминирующим, поэтому дырки в зоне **I** являются основными носителями, а электроны зоны **II** — неосновными.

Полупроводники описанного типа называются дырочными или полупроводниками p- типа. Часто их называют акцепторными полупроводниками.

3.4. Контакт электронного и дырочного полупроводников (*p-n-* переход)

p-n- переходом называется электрический контакт двух примесных полупроводников с различным типом проводимости.

3.4.1. Равновесное состояние *p-n-* перехода

Равновесное состояние соответствует отсутствию внешнего напряжения на p-n- переходе (рис. 3.4).

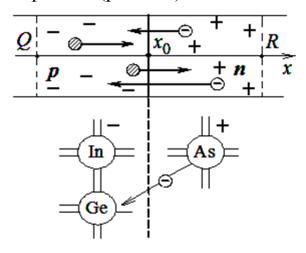


Рис. 3.4. Образование обедненного слоя на границе *p-n*- полупроводников

Верхняя часть рисунка изображает область диода вблизи p-n- перехода (точка x_0). Шарики моделируют свободные носители заряда. Дырки показаны заштрихованными, электроны – с символом заряда внутри. И те и другие оторвались от примесных атомов, превратившихся в ионы, также показанные символами зарядов. Поскольку концентрация электронов в полупроводнике *n*-типа больше, полупроводнике *p*- типа, часть чем В электронов диффундирует из n- области в p- область; дырки же наоборот, диффундируют из p- области в n- область. Электроны, оказавшиеся в р- полупроводнике, рекомбинируют с дырками, то есть занимают вакантные места в атоме германия (нижняя часть рис. 3.4). В результате рекомбинации электрон как носитель тока исчезает, ион германия превращается в нейтральный атом, а на атоме акцептора нескомпенсированный отрицательный появится заряд. диффузии оказавшаяся результате *n*- полупроводнике, В В рекомбинирует с основным носителем – электроном, в результате донорном атоме нескомпенсированный чего на появится положительный заряд. Так как акцепторные и донорные атомы

кристаллической решетки находятся узлах И не ΜΟΓΥΤ обе стороны границы ПО между двумя перемещаться, полупроводниками образуется двойной слой пространственного заряда - отрицательные заряды ионов акцепторных атомов в р- области и положительные заряды ионов донорных атомов в *n*- области (область QR на рис. 3.4). Возникающее электрическое поле противодействует дальнейшей контактное диффузии основных носителей тока, то есть создает для них потенциальный барьер. Высота барьера $U_k \approx 0.7 \text{ B}$ для Ge и $U_k \approx 1.1 \text{ B}$ для Si.

В условиях равновесия диффузионный поток электронов из n- в p- область, создающий ток основных носителей I_n через p-n- переход, уравновешивается встречным потоком электронов из p- в n- область, создающим ток неосновных носителей I_{gen} . То же самое можно сказать и о токе, создаваемом дырками.

Следовательно, в условиях равновесия $I_{gen} + I_n = 0$ и результирующий ток, создаваемый потоком носителей, равен нулю.

3.4.2. Выпрямляющие свойства *p-n-* перехода

Внешнее электрическое поле изменяет высоту барьера и нарушает равновесие потоков носителей тока через *p-n-* переход.

Приложим к p-n- переходу, находившемуся в равновесии разность (рис. 3.5, a), внешнюю потенциалов Uпрямом *n*- области направлении, подключив К отрицательный источника, к p- области — положительный (рис. 3.5, б). На рис. 3.5 (б) и 3.5 (в), E и E_k – напряженности электрических полей внешнего и контактного, соответственно. Эта разность потенциалов вызывает понижение потенциального барьера для основных носителей до значения ($eU_k - eU$).

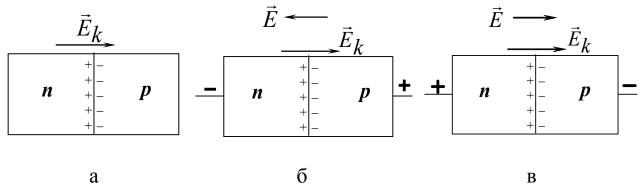


Рис. 3.5. Взаимная ориентация внешнего и внутреннего электрических полей

в р-n- переходе при различной полярности подключения источника ЭДС

Поэтому поток электронов из n- в p- полупроводник увеличит ток основных носителей. Ток неосновных носителей останется без изменения, так как поток неосновных носителей от высоты потенциального барьера не зависит. Через p-n- переход будет протекать отличный от нуля результирующий ток (прямой ток).

Приложим теперь К р-и- переходу внешнюю разность потенциалов (U) в обратном направлении, подключив к p- области источника полюс напряжения, *n*- области – отрицательный К (рис. 3.5, в). Под действием положительный этой разности потенциалов потенциальный барьер перехода повысится до значения $(eU_k + eU)$, что вызовет уменьшение потока основных носителей и электрического тока, созданного ими. Более подробный анализ показывает, ЧТО зависимость тока через ДИОД otвнешнего напряжения U имеет вид

$$I(U) = I_{gen} \left(e^{eU/kT} - 1 \right).$$

Как видно, при этом $I\left(0\right)=0$ и $\left|I\left(-\infty\right)\right|=I_{gen}$.

Зависимость тока от напряжения для диода характеризуется резко выраженной нелинейностью. Левую и правую полуплоскости системы координат, ввиду малости обратного тока, приходится вычерчивать в разных масштабах (рис. 3.6). Это приводит к появлению излома на графике в центре координат.

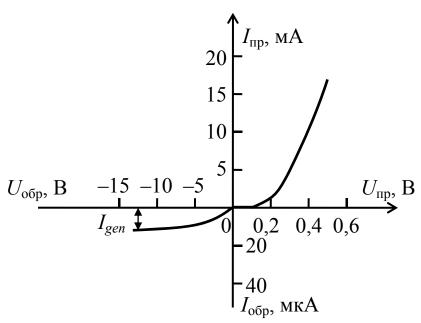


Рис. 3.6. Вольт-амперная характеристика диода ІД507А

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Объект исследования (ОИ) представляет собой вилку с переключателем, в корпусе которой установлены образцы — промышленные диоды. ОИ вставлен в БУИ — блок управления и индикации. На переднюю панель БУИ выведены:

- 1) кнопки набора режимов работы «BAX-ФВХ», «прямаяобратная» и лампочки для индикации выбранных режимов;
- 2) кнопки «+», «-», предназначенные для установки напряжения в режимах «ВАХ» «прямая» и «ВАХ» «обратная»;
 - 3) розетка для установки объекта исследования.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Электропитание экспериментальной установки осуществляется от розетки, расположенной на стене, к которой подведено сетевое напряжение 220 В. Установка подключается проводом с двухполосной вилкой. Заземление установки осуществляется через одну из полос, поэтому специальный «земляной» провод отсутствует. Все токоведущие части установки закрыты, что исключает их касание.

При выполнении работы необходимо:

- 1) внимательно ознакомиться с заданием и экспериментальной установкой;
- 2) проверить изоляцию токоведущего провода, о замеченных неисправностях немедленно сообщить преподавателю;
- 3) не загромождать лабораторный стол с установкой посторонними предметами;
 - 4) не оставлять без присмотра работающую установку;
- 5) по окончании работы выключить установку, не отсоединяя провода от сети и привести в порядок рабочее место.

6. ЗАДАНИЯ

- 1. Построение вольт-амперной характеристики диода.
- 2. Построение зависимости сопротивления диода от величины приложенного напряжения.

7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Построение вольт-амперной характеристики диода

1. Переключатель на ОИ поставить в положение, указанное преподавателем.

- 2. Включите переключатель «Сеть» на задней панели БУИ. При этом на всех индикаторах должны установиться нули и загореться лампочки «ВАХ» и «прямая». (На последнем разряде индикаторов возможно появление цифр 1-3, что следует отнести к систематической ошибке прибора.)
 - 3. Дайте прогреться установке 2 мин.
- 4. Начните увеличивать напряжение от 0,00 до 1,00 В с шагом ΔU = 0,05 В. Вначале (при малых U < 0,50 В) прямой ток заметен не будет; микроамперметр будет показывать нули. Продолжайте увеличивать напряжение U. Когда вместо нулей на индикаторе тока появятся отличные от нуля (0,0 µА) цифры, начните заполнять вольт-амперной характеристики (BAX) p-n- перехода, табл. 7.1 включенного В прямом пропускном направлении. В автоматического выбора пределов измерения амперметра, в ходе увеличения U произойдёт переключение пределов измерений от микроампер миллиамперам. В табл. 7.1 следует выбрать миллиамперы. По достижении величины U = 1,00 B, нажмите кнопку «сброс».

Таблица 7.1

U_{np},B	
$I_{\rm пр}$, м ${ m A}$	

5. Постройте график BAX p-n- перехода для прямого включения, выбрав удобный масштаб (размер графика — не менее $10 \times 10 \text{ см}^2$). Для этого нанесите экспериментальные точки на вашу координатную сетку и соедините экспериментальные точки гладкой кривой. Пример графика показан на рис. 7.1.

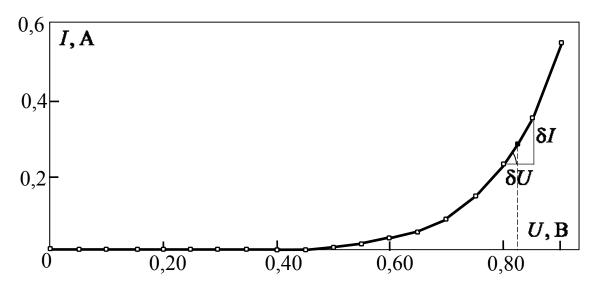


Рис. 7.1. Вольт-амперная характеристика диода Д7 (один из используемых в установке)

Задание 2. Построение зависимости сопротивления диода от величины приложенного напряжения

В отличие от резистора у диода нет определённого сопротивления, это нелинейный прибор. Но для диода можно ввести так называемое дифференциальное сопротивление, зависящее от приложенного напряжения U по формуле

$$R(U) = \left(\frac{dU}{dI}\right)_{U},\tag{7.1}$$

при расчётах R, дифференциалы заменяются конечными приращениями $\Delta U = U_2 - U_1$ для напряжения и $\Delta I = I_2 - I_1 -$ для тока соответственно

$$R(U) = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}. (7.2)$$

Для определения сопротивления R(U) необходимо:

1. Для каждого U из табл. 7.1 вычислить величину

$$\Delta I = I_2 - I_1 = I(U + \Delta U) - I(U), \tag{7.3}$$

взяв $\Delta U = 0.05 \text{ B}.$

- 2. Для каждого значения U вычислить отношение $R = \Delta U / \Delta I$. Это будут значения R для напряжений, равных полусумме соседних значений напряжения в табл. 7.1. Например, на рис. 7.1 показано построение, необходимое для вычисления $R = \Delta U / \Delta I$ при U = 0.825 В.
 - 3. Занесите полученные данные в табл. 7.2.

$U_{\mathrm{np}},\mathrm{B}$	
$R_{\rm пp}$, Ом	

- 4. Постройте график зависимости R = R(U).
- 5. Рассчитайте абсолютную ΔR и относительную ε_R погрешности величины R для одного значения U по указанию преподавателя.

При этом за абсолютную погрешность числителя и знаменателя в формуле (7.1) нужно взять цену деления соответствующего прибора. Вычислите относительную погрешность ε_R определения дифференциального сопротивления по формуле

$$\varepsilon_R = \varepsilon_{\Lambda IJ} + \varepsilon_{\Lambda I}, \tag{7.4}$$

где $\varepsilon_{\Delta U}$ и $\varepsilon_{\Delta I}$ – относительные погрешности определения величин ΔU и ΔI в числителе и знаменателе формулы (7.2) соответственно. Подробно эта формула выглядит так

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\delta U}{U_2 - U_1} + \frac{\delta I}{I_2 - I_1},$$

где δU — цена деления вольтметра, δI — цена деления амперметра. Зная ε_R , определите абсолютную погрешность ΔR по формуле $\Delta R = R \cdot \varepsilon_R$.

Контрольные вопросы

- 1. Как возникает электронная проводимость в полупроводниках n- типа?
- 2. Как возникает дырочная проводимость в полупроводниках p- типа?
- 3. Почему на границе полупроводников p- и n- типа возникает обеднённый слой?
 - 4. Какова природа электрических зарядов на границе *p-n-* перехода?
 - 5. Чему равен ток через p-n- переход в условиях равновесия?
 - 6. Каким выражением определяется ток через *p-n* переход?
 - 7. Чем объясняется односторонняя проводимость *p-n-* перехода?
 - 8. Как включить p-n- переход в прямом направлении?
- 9. Как зависит сопротивление *p-n-* перехода от напряжения при прямом и обратном включении?

Требования к содержанию и оформлению отчёта

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- 1. Номер и название лабораторной работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Теоретические основы принципов работы полупроводникового диода под напряжением.
 - 4. Схему установки.
 - 5. Таблицы с результатами измерений I(U) и вычислений R(U).
 - 6. Графики зависимостей I(U) и R(U).
- 7. Результаты вычисления погрешности косвенного измерения величины R(U) одного значения U.
 - 8. Выводы.

Критерии результативности выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа считается выполненной, если студент:

- умеет объяснять физические принципы работы полупроводникового диода, в частности явление односторонней проводимости диода;
 - правильно выполнил измерения и расчеты;
 - грамотно построил графики;
- представил отчет, соответствующий предъявляемым требованиям;
 - знает ответы на все контрольные вопросы.

Список литературы

- 1. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Академия, 2012.
- 2. *Левинштейн М. Е.*, Симин Г. С. Барьеры. М.: Наука, 1987.

Составитель САЗОНОВ Сергей Николаевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

Методические указания к лабораторной работе № 78 по дисциплине «Физика»

Подписано в печать 2015. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Nimes New Roman. Усл. печ. л. 1,1. Усл.-кр.-отт. 1,1. Уч-изд.л. 0,9. Тираж 100 экз. Заказ № ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» Редакционно-издательский комплекс УГАТУ 450000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12